

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 2 部門第 1 区分

【発行日】平成 20 年 1 月 17 日 (2008.1.17)

【公開番号】特開 2002-273144 (P2002-273144A)

【公開日】平成 14 年 9 月 24 日 (2002.9.24)

【出願番号】特願 2001-81017 (P2001-81017)

【国際特許分類】

B 0 1 D 53/04 (2006.01)

C 0 1 B 17/45 (2006.01)

C 0 1 B 21/083 (2006.01)

H 0 1 L 21/302 (2006.01)

【F I】

B 0 1 D 53/04 G

C 0 1 B 17/45 G

C 0 1 B 21/083

H 0 1 L 21/302 4 0 0

【手続補正書】

【提出日】平成 19 年 11 月 9 日 (2007.11.9)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 2 4

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 2 4】

そして、C F 4 + 窒素を濃縮装置 2 2、N F 3 + 窒素を濃縮装置 2 4 に供給する。この濃縮装置 2 2、2 4 も上述の濃縮装置 1 8 と同じく、膜分離装置や深冷冷却装置が用いられる。特に、膜分離装置において、濃縮ガスを何度も循環したり、多段としたり、深冷冷却分離装置を用いることで、窒素をほぼ 1 0 0 % 分離して、純粋な、濃度 1 0 0 % の C F 4 ガスおよび N F 3 ガスを得ることができる。